



A61 k 7/12

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 37554

Kl. 30 h, 13/08

Centralne Laboratorium Chemiczne, Spółdzielnia Pracy*)

Warszawa, Polska

Sztuczna henna

Udzielono patentu z mocą od dnia 17 kwietnia 1954 r.

W patencie nr 36844 opisano sposób wytwarzania p-toluenodwuaminy, która stanowi barwnik nadający się do barwienia włosów i futer i która nadaje się do wytwarzania sztucznej henny po zmieszaniu jej z innymi składnikami jak np. ze skrobią, białkiem kurzym, dwuwęglanem sodowym itd.

Wolna p-toluenodwuamina jako podstawowy składnik sztucznej henny wykazuje jednak pewne niedogodności, a mianowicie ulega ona utlenianiu, wskutek czego trzeba ją przechowywać w próżni, po zmieszaniu zaś jej z innymi składnikami sztucznej henny, henna ta podczas przechowywania ciemnieje. W celu zaradzenia tej niedogodności proponowano stosować do wytwarzania sztucznej henny zamiast wolnej aminy dwuchlorowodorek p-tolueno-dwuaminy o wzorze $C_7H_{10}N_2 \cdot 2HCl$.

Sztuczna henna zawierająca dwuchlorowodorek p-toluenodwuaminy wprawdzie nie ciemnieje podczas przechowywania, sam zaś dwuchlorowodorek daje się przechowywać w zwykłych naczyniach, to jednak tego rodzaju sztuczna henna barwi włosy zbyt powolnie co utrudnia jej zastosowanie w celach kosmetycznych.

Obecnie wykryto, że można wytworzyć sztuczną hennę o wymaganych własnościach, nie ulegającą utlenianiu, skoro jako jej składnik podstawowy zastosować jednochlorowodorek p-toluenodwuaminy o wzorze $C_7H_{10}N_2 \cdot HCl$. Jednochlorowodorek p-toluenodwuaminy daje się przechowywać bez obawy utleniania w zwykłych naczyniach, miesza się doskonale ze zwy-

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest mgr Eugeniusz Karnicki.

kle stosowanymi składnikami sztucznej henny, która ponadto barwi włosy w takim samym czasie jak i henna naturalna.

dnik zasadniczy, zawiera jednochlorowodrek p-toluenodwuaminy.

Zastrzeżenie patentowe

Sztuczna henna, znamienna tym, że jako skła-

Centralne Laboratorium
Chemiczne
Spółdzielnia Pracy

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych